

Title (en)

FOCUSED SUBSTRATE ALTERATION.

Title (de)

VERÄNDERUNG EINES SUBSTRATS DURCH EINEN FOKUSSIERTEN STRAHL.

Title (fr)

ALTERATION FOCALISEE D'UN SUBSTRAT.

Publication

**EP 0198908 A1 19861029 (EN)**

Application

**EP 85905575 A 19851025**

Priority

- US 66525184 A 19841026
- US 76937085 A 19850826

Abstract (en)

[origin: WO8602774A1] Alteration of a precisely located site on a substrate (35) using apparatus that comprises: a) a focusable ion source (10); b) a lens (22) positioned to focus ions emitted by the source into an ion beam (124); c) a vacuum chamber (30) for containing the substrate site in the path of the ion beam; and d) a directed gas inlet (55) positioned to provide a localized supply of a substance at the site whereby the beam interacts with the substances to cause the alteration localized at the site. Methods of performing the alteration are also disclosed.

Abstract (fr)

On altère un site précisément localisé sur un substrat (35) en utilisant un appareillage qui comprend: a) une source d'ions (10) susceptible d'être focalisée; b) une lentille (22) positionnée de façon à focaliser les ions émis par la source en un faisceau d'ions (124); c) une chambre à vide (30) pour contenir le site du substrat dans la trajectoire du faisceau d'ions; et d) une conduite d'admission dirigée des gaz (55) positionnée pour fournir localement la substance gazeuse au niveau du site. Le faisceau interagit avec la substance pour causer l'altération localisée dans le site. L'invention porte également sur des procédés utilisés pour exécuter l'altération.

IPC 1-7

**H01J 37/317**

IPC 8 full level

**G03F 1/00** (2006.01); **H01J 37/317** (2006.01)

CPC (source: EP)

**G03F 1/74** (2013.01); **H01J 37/3178** (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

**WO 8602774 A1 19860509**; EP 0198907 A1 19861029; EP 0198908 A1 19861029; EP 0198908 A4 19870302; WO 8602581 A1 19860509

DOCDB simple family (application)

**US 8502109 W 19851025**; EP 85905574 A 19851025; EP 85905575 A 19851025; US 8502108 W 19851025